

知的財産報告書

東京エレクトロンのコア技術は、半導体およびFPD製造のためのプロセス技術およびメカトロニクス技術であり、製品競争力強化のための技術開発を推進しています。また今年度から利益率向上に向けた取り組みとして、①高付加価値の新製品のリリース、②製造力の向上、③ポストセールスビジネスの拡大、をテーマとして掲げて事業を進めています。このような状況のもと、独自開発した自社技術および自社製品の知的財産権による保護なくしては、ビジネスを円滑に進めることができません。

当社は、知的財産戦略が技術戦略および製品戦略と三位一体となることによって初めて、期待した効果が最大限に発揮され则认为しています。

また、昨今の半導体メーカーとの役割分業化により、装置のみならずプロセス、複数プロセスのインテグレーション、さらにはプロセスコントロールへと、当社の役割が拡張を続けることによる知的財産権保護の多様化に対しても、装置レシピや、ソフトウェア技術、並びに複数の製造装置のプロセス管理技術等に関する特許出願による対応を積極的に行うことで保護強化に努めています。

知的財産の取得・管理、営業秘密管理、技術流出防止に関する方針

当社においては「知的財産権に関する規程」で知的財産権の取り扱いについて定めており、昨年より施行された改正特許法の趣旨に基づき、規程の改定を行いました。この規程においては、発明・考案・創作者には、特許、実用新案、意匠などの出願時一時金と、社内実施、ライセンスなどの社外実施の実績に応じた補償金とを支払うこととしています。また、技術者による発明・考案・創作への意欲向上のため、発明奨励賞などの発明報奨制度を制定しています。

また、営業秘密などは、「技術・営業情報管理規程」および「技術・営業情報管理運用マニュアル」に基づいて厳密に管理されており、「営業秘密管理指針」および「技術流出防止指針」で定められる内容とほぼ同等の管理内容となっています。

また、資材・調達部門との連携強化により、部品レベルでの模倣・海賊品対策を強化しています。さらに、日本国内のみならず、米・アジア諸国の現地の法律事務所との連携や、経済産業省や日本貿易振興機構、知的財産協会等の機関との連携、また、様々な活動への参画等を通して、模倣・海賊品対策への積極的な活動を行っています。

知的財産権の出願状況

2006年3月末日時点での、当社の国内外における特許出願状況は別表のとおりです。既に、全体的には国内外への特許取得の厳選化を進めていますが、各事業分野における製造拠点・市場を考慮し、日本を含む出願国の見直しを実施しています。特に、過去数年間の施策であった米国への出願強化のほか、東アジアを中心とした模倣・海賊品対策として、中国、韓国、台湾などへの出願強化を行っております。

ライセンス関連活動の事業への貢献

当社は自社開発製品や開発技術について、出願・権利化に成功した知的財産権を競合他社にライセンスアウトすることで収益を上げるのではなく、自社製品における技術的差別化や競争優位性確保を重点として、知的財産戦略を構築・実行しています。技術がますます高度化、複雑化している半導体およびFPD製造装置分野では、最先端技術を導入した新製品を効率良く開発し早期に市場投入するために、あらゆる知的財産権を有効に活用することが必要です。当社は、最先端技術の導入、研究開発効率の向上、新製品の早期市場投入を重視し、自社開発による知的財産の利用と同様に他社の知的財産を尊重し、ライセンスインなどを行うことで有効活用しています。

今後は、自社保有の知的財産権によっては当社事業領域外の第三者や協業パートナーへの譲渡やライセンスなども検討していく予定です。

